

中国知財の最新動向— AI・商標・半導体を中心に相次ぐ制度整備 —

弁理士 加藤 真司

中国では 2026 年に入り、知的財産制度をめぐる重要な制度改正や新たな司法方針が相次いでいます。特に 9 月には、AI 関連紛争についての最高人民法院の新たな意見が公表されたほか、2027 年施行の改正商標法に対応する審査ガイドライン案が公表され、さらに半導体分野では集積回路配置設計の保護制度について新たな実施細則が公布されました。

これらの動きの背景には、中国政府が 2026～2030 年を対象として策定した「知的財産権保護・運用第 15 次五か年計画」があります。同計画では、2030 年までに知的財産の保護、活用、管理、サービス等をさらに強化し、「知的財産強国」の建設を進めることが掲げられています。

今回は、日本企業にとっても特に注目される最近の 5 つの動きを紹介します。

1. 最高人民法院が AI 関連紛争の審理方針を公表

2026 年 9 月 7 日、中国最高人民法院は「人工知能関連紛争事件を適法に審理することに関する意見」（法発〔2026〕10 号）（以下、「意見」と言います。）を公表しました。AI 技術の急速な発展に伴って生じる各種の民事紛争について、各級人民法院が事件を審理する際の基本的な考え方を示すものです。

生成 AI をはじめとする AI 技術では、モデルの開発・学習、AI サービスの提供、ユーザーによる利用という複数の段階に多数の当事者が関与します。このため、AI によって第三者の権利が侵害された場合に、開発者、サービス提供者、ユーザー等のうち誰がどの範囲で責任を負うかが重要な問題となります。

今回の「意見」は、AI 関連紛争について、技術革新を促進する一方、著作権、人格権、個人情報等の権

利利益を適切に保護するという考え方を示しています。最高人民法院は、この「意見」について、AI による顔・音声の生成、生成 AI によるコンテンツの侵害、AI オープンソースソフトウェアをめぐる責任など、AI の発展によって生じている新たな法律問題に対応するものと説明しています。

特に知的財産との関係では、AI の学習・開発段階における既存の著作物やデータの利用、AI によって生成されたコンテンツによる第三者の著作権侵害、AI 関連技術の権利保護などが今後重要な論点になると考えられます。

【日本企業へのコメント】

中国で AI サービスを提供する企業だけでなく、AI を自社製品や業務システムに組み込む日本企業にとっても、AI 関連の知的財産リスクを管理する必要性が高まっています。

特に、AI モデルの開発に使用したデータの出所、利用許諾の有無、モデルの開発過程等について、後から説明できるよう記録を残しておくことが重要です。また、外部の AI サービスを利用する場合にも、生成されたコンテンツをそのまま広告、ソフトウェア、製品デザイン等に使用するのはなく、第三者の権利を侵害していないか確認する体制を整えることが望まれます。

2. 改正商標法の施行に向け、審査実務・司法解釈が具体化

中国では 2026 年 6 月 26 日に商標法が全面改正され、改正法は 2027 年 1 月 1 日から施行されます。今回の改正は、従来の 8 章 73 条から 9 章 87 条へと拡充される大規模なものであり、中国国家知識産権局

(CNIPA)は、1983年の商標法施行以来初めての「全面的改正」と位置付けています。

改正法では、インターネット等を通じた商標使用を明確に商標法の対象としたほか、使用を目的とせず、通常の生産・経営上の必要性を明らかに超える商標登録出願を認めないことなど、悪意の商標出願に対する規制が強化されています。

そして9月に入り、改正法を実際にどのように運用するかについて、さらに具体的な動きが出てきました。

CNIPAは9月28日、改正商標法に対応した「商標審査審理指南（商標審査・審理ガイドライン）」の改正案を公表しました。改正商標法の重要な改正事項や企業等から関心の高い事項を踏まえて審査基準を整備するもので、11月12日まで意見募集が行われています。

同日には、改正商標法施行前後の案件をどのように取り扱うかを定める「改正商標法施行に伴う関連業務処理弁法」の案も公表されています。

司法側でも動きがあります。最高人民法院は9月14日、改正商標法の2027年1月1日の施行に備えて、「商標法の時間的効力に関する若干の規定」と「商標権付与・権利確定行政事件に関する規定」の二つの司法解釈案を公表し、意見募集を開始しました。

つまり、中国の商標制度は現在、単に「商標法が改正された」という段階から、2027年1月の施行に向けて、CNIPAの審査実務と裁判所の司法実務を具体化する段階に入ったといえます。

【日本企業へのコメント】

中国で多数の商標を保有する企業は、2027年1月の施行に向け、自社の商標ポートフォリオを一度確認しておくことが望まれます。

特に、実際に使用していない商標を多数保有している場合、あるいは第三者による先取り出願への対応を必要としている場合には、改正法及び今後確定する審査ガイドラインが実務にどのような影響を及ぼすか注意する必要があります。

3. 半導体 IP の保護を強化—集積回路配置設計制度を改正

半導体分野でも重要な制度改正が行われています。

中国では、半導体集積回路の回路配置を「集積回路配置設計（集成电路布图设计）」として、特許とは別の知的財産権によって保護しています。

2026年7月23日に改正「集積回路配置設計保護条例」が公布され、同条例は10月15日から施行されます。これを受けてCNIPAは9月30日、新たな「集積回路配置設計保護条例実施細則」を公布しました。新しい実施細則は10月30日から施行されます。

今回の改正では、電子出願・電子送達に関する規定の整備のほか、配置設計の独創性に関する声明、第三者による取消請求、口頭審理、専有権の譲渡・ライセンス・質権設定等について手続が整備されています。

また、CNIPAは同じ9月30日に、「集積回路配置設計審査及び行政裁決指南」の改正版も公表しました。こちらも10月30日から施行され、2019年に公表された従来の試行版ガイドラインは廃止されます。

今回の制度整備は、単に配置設計の登録手続を見直すだけではなく、登録後の権利の有効性を争う手続や、侵害紛争を行政的に処理する仕組みについても整備するものであり、中国が半導体分野の知的財産保護を一段と体系化していることを示しています。

【日本企業へのコメント】

中国で半導体の研究開発、設計、製造委託等を行う企業にとっては、発明を特許で保護するだけでなく、回路配置そのものについて「集積回路配置設計」の保護制度を利用できるか検討する余地があります。

特に、中国企業との共同開発や中国企業への製造委託を行う場合には、特許、営業秘密、集積回路配置設計という複数の保護手段を組み合わせることが重要になると考えられます。

4. 新しい特許優先審査制度が9月1日からスタート

特許については、改正「専利優先審査管理弁法」が2026年9月1日に施行されました。これに伴い、2017年の旧管理弁法は廃止されています。

新制度の対象には、一定の発明・実用新案・意匠出願に加え、拒絶査定に対する復審や無効宣告事件も含まれます。

優先審査が認められた場合、原則として、発明特許については45日以内に最初の処理を行い、1年以内に審査を終えることとされています。また、実用新案・意匠は2か月以内、復審事件は7か月以内、発明・実用新案の無効宣告事件は5か月以内、意匠の無効宣告事件は4か月以内の処理が予定されています。

一方、優先審査を利用する場合には手続管理にも注意が必要です。

例えば、発明特許の審査意見通知に対する応答期間は発行日から1か月とされており、期間延長を請求した場合には、優先審査が打ち切れ、通常審査に戻されることがあります。また、優先審査開始後に一定の自発補正を行った場合も、優先審査が終了する可能性があります。

9月1日以降の優先審査請求には新しい請求書を使用する必要があり、復審・無効宣告事件についても、新しいオンライン手続に移行しています。

さらに、中国では優先審査だけでなく、快速審査、遅延審査、集中審査などを組み合わせた「必要に応じた審査（按需審査）」を推進しています。CNIPAはこれを、「早くすべきものは早く、遅くすべきものは遅く」という考え方にに基づき、企業の特許戦略に応じて審査速度を調整する仕組みとして位置付けています。

【日本企業へのコメント】

中国で競合製品が既に市場に出ている場合や、製品発売前に早期に権利を確定させたい場合には、優先審査の利用価値は高いと考えられます。

一方、まだクレームの方向性を検討する必要がある案件では、優先審査開始後の補正制限等を考慮すると、必ずしも早期に優先審査を請求することが最

善とは限りません。中国出願についても、事業計画に合わせて「審査を早めるか、通常どおり進めるか、あえて遅らせるか」を選択するという発想が重要になっています。

5. 「第15次五か年計画」に見る2030年までの中国知財政策

これら一連の制度改正を理解する上で重要なのが、中国国務院が2026年7月27日に公布した「知的財産権保護・運用第15次五か年計画」です。

同計画は2026～2030年の中国知財政策の基本方針を示すものであり、2030年までに知的財産の総合力と国際競争力をさらに高め、知的財産権の保護、活用、公共サービス、管理体制等を強化することを目標としています。

具体的には、特許関連制度の継続的な改善、商標法及びその実施条例の全面的な改正、著作権関連制度の整備、集積回路配置設計制度の改正、営業秘密保護制度の改善、知的財産分野における独占禁止制度の整備、知財税関保護制度の見直しなど、非常に幅広い制度改革が予定されています。

特許審査についても、産業の発展と審査実務との連携を強化するとともに、複数の技術分野にまたがる発明について新たな審査方式を導入する方向性が示されています。CNIPAは、特にAI、大規模モデルなど複数技術が融合する分野を念頭に、審査体制を産業・技術の変化に対応させる考えを示しています。

今回紹介した、商標法の全面改正、特許優先審査制度の見直し、集積回路配置設計制度の改正なども、このような中国の中長期的な知財政策の中で捉えることができます。

おわりに

2026年秋の中国知財制度の動きを見ると、単に個別の法律や規則を改正するだけではなく、AI、半導体、デジタル経済などの新しい産業・技術に対応する形で、知的財産制度全体を再構築しようとする方向性が見えて

きます。

AI 分野では最高人民法院が新たな紛争類型に対応する司法方針を示し、商標分野では 2027 年の改正法施行に向けて審査実務・司法実務の具体化が始まりました。また、半導体分野では集積回路配置設計の保護制度が強化され、特許についても企業の事業戦略に応じて審査速度を選択する「必要に応じた審査」が進められてい

ます。

中国で事業を行う日本企業にとっては、中国知財を単に「中国で特許や商標を取得する」という観点だけで捉えるのではなく、AI・データの管理、営業秘密、半導体 IP、ブランド保護、権利化のタイミング、紛争対応まで含めて総合的に知財戦略を検討することが、これまで以上に重要になっているといえるでしょう。



KSI パートナース法律特許事務所

〒150-0031

東京都渋谷区板丘町22-14 N.E.S ヒルS棟4階

TEL: 03-6455-3679

E-MAIL: patent@ksilawpat.jp



ksilawpat.jp